### 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類は下記の出願書類の謄本に相違ないことを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

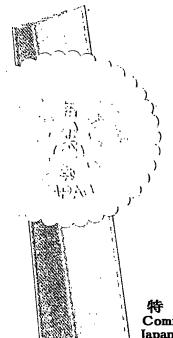
2003年11月26日

出 顧 番 号 Application Number:

PCT/JP03/15090

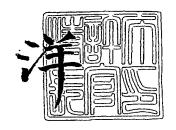
出 顏 人
Applicant(s):

三菱電機株式会社中 慈朗 期川 博志 小林 淳二 外山 悟 即子 原 英司



2005年 1月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 1) 11



547878W001

0	受理官庁記入欄	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
0-1	国際出願番号	PCT/JP03/15090	
0-2	国際出願日		
	,	26.11.03	
0-3	(受付印)	PCT International Application 日 本 国 特 許 庁	
<del></del>	<u></u>		
0-4	様式-PCT/RO/101  この特許協力条約に基づく国際  出願願書は、		
0-4-1	右記によって作成された。 	PCT-EASY Version 2.92 (updated 01.07.2003)	
0-5	申立て		
·	出願人は、この国際出願が特許 協力条約に従って処理されるこ とを請求する。		
0-6	出願人によって指定された受理 官庁	日本国特許庁(RO/JP)	
0-7	出願人又は代理人の書類記号	547878W001	
ī	発明の名称	微量含有物の分析方法	
II	出願人		
II-1	この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)	
<b>II-2</b> .	右の指定国についての出願人である。	米国を除くすべての指定国 (all designated States except US)	
II-4ja	名称	三菱電機株式会社	
II-4en	Name	MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA	
II-5ja	あて名:	100-8310 日本国	
II-6en	Address:	東京都 千代由区 丸の内二丁目2番3号 2-3,Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan	
II-6	国籍 (国名)	日本国 JP	
11-7	住所(国名)	日本国 JP	
· II-8	電話番号	03-3213-3421	
11-9	ファクシミリ番号	03-3218-2460	
III-1	その他の出願人又は発明者		
III-1-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)	
III-1-2	右の指定国についての出願人である。		
III-1-4 <b>j</b>	氏名(姓名)	中 慈朗	
III-1-4e	Name (LAST, First)	NAKA, Jiro	
n III-1-5j a		100-8310 日本国 東京都 千代田区	
III-1-5e n (	Address:	丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内 c/o Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha, 2-3,Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan	
III-1-6 III-1-7	国籍(国名) 住所(国名)	日本国 JP 日本国 JP	

111-2	その他の出願人又は発明者	
111-2-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-2-2	右の指定国についての出願人で	五願人及び発明者である (appireant and inventor)  米国のみ (US only)
	ある。 ·	
111-2-4j a	氏名(姓名)	黒川  博志
111-2-4e	Name (LAST, First)	KUROKAWA, Hiroshi
ÏII-2-5j	あて名: ·	100-8310 日本国
G.		東京都 千代田区
	,	丸の内二丁目2番3号
111-2-5e	Address:	三菱電機株式会社内
n .	Address:	c/o Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha, 2-3,Marunouchi 2-Chome,
		Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
	,	Japan
111-2-6	国籍(国名)	日本国 JP
111-2-7	住所 (国名)	日本国 JP
111-3	その他の出願人又は発明者	
III-3-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111-3-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-3-4j	氏名(姓名)	小林 淳二
III-3-4e	Name (LAST, First)	KOBAYASHI, Junji
n III-3-5j	あて名:	100-8310 日本国
a	Ţ	東京都 千代田区 丸の内二丁目 2番 3 号
•		丸の内二丁目2番3号
*** 0 5-		三菱電機株式会社内
111-3-5e n	Address:	c/o Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha,
		2-3,Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
•		Japan
III-3-6	国籍 (国名)	日本国 JP
111-3-7	住所 (国名)	日本国 JP
111-4	その他の出願人又は発明者	
III-4-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111-4-2	右の指定国についての出願人で   ある。	米国のみ (US only)
III <b>-4-4j</b>	のる。  氏名(姓名)	外山 悟
III-4-4e	Name (LAST, First)	TOYAMA, Satoru
n III <b>-4</b> -5j	あて名:	100-8310 日本国
a		東京都 千代田区
		丸の内二丁目2番3号
		丸の内二丁目2番3号  三菱電機株式会社内
III-4-5e n	Address:	lc/o Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha,
		2-3, Marunouchi 2-Chome,
		Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
111-4-6	·  国籍 (国名)	Japan  日本国 JP
111-4-7	国籍(国名)  住所(国名)	日本国 JP
	正/// (四石)	

	The state of the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
111-5	その他の出願人又は発明者	dom to a second the section of the s
III-5-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
111-5-2	右の指定国についての出願人である。	米国のみ (US only)
III-5-4 <b>j</b>	氏名(姓名)	平野 則子
111-5-4e	Name (LAST, First)	HIRANO, Noriko
n 111-5-5j a	あて名:	100-8310 日本国 東京都 千代田区
		元の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内
111-5-бе	Address:	c/o Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha,
n ,		2-3.Marunouchi 2-Chome,
		Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
		Japan
111-5-6 111-5-7	国籍(国名)	日本国 JP  日本国 JP
111-6	住所(国名)  その他の出願人又は発明者	
111-6-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である(applicant and inventor)
111-6-2	右の指定国についての出願人で	
III-6 <b>-4j</b>	ある。 氏名(姓名)	原英司
a III-6-4e		HARA, Eiji
n III-6-5j		100-8310 日本国
a.		東京都 千代田区 丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内
111-6-5e n	Address:	c/o Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha, 2-3,Marunouchi 2-Chome,
		Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
III-6-6	同然 (图名)	Japan
111-6-7	国籍(国名)  住所(国名)	日本国 JP
IV-1	代理人又は共通の代表者、通知	
., .	のあて名	
	下記の者は国際機関において右   記のごとく出願人のために行動	代理人(agent)
IV-1-1 ja	する。    氏名(姓名)	宮田 金雄
	Name (LAST, First)	西丘 並為 MIYATA, Kaneo
IV-1-2ja		1100-8310 日本国
	W C-11.	東京都 千代田区
		対の内二丁目2番3号
		三菱電機株式会社内
IV-1-2ei	Address:	c/o Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha, 2-3, Marunouchi 2-Chome,
		Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
		Japan
IV-1-3	電話番号	03-3213-3421
IV-1-4	ファクシミリ番号	03-3218-2460
1V-2	その他の代理人	筆頭代理人と同じあて名を有する代理人 (additiona)
		agent(s) with same address as first named agent)
	a   氏名	高瀬彌平
IV-2-1e	n Name(s)	TAKASE, Yahei

V	国の指定	1	
V-1	広域特許	FP: AT BE CHALL CY DE DI	( ES FI FR GB GR IE IT LU
	(他の種類の保護又は取扱いを	MC NL PT SE TR	CEOTITION OF OR IL IT ED
	求める場合には括弧内に記載す		特許協力条約の締約国であ
	る。)	る他の国	
V-2	国内特許	CN JP US	
	(他の種類の保護又は取扱いを		
•	水める場合には括弧内に記載す		•
V-5	る。)  指定の確認の宣言		·
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	出願人は、上記の指定に加えて   担則4 9(b)の担定に基づき	·	
	、規則4.9(b)の規定に基づき、 特許協力条約のもとで認められ		•
	る他の全ての国の指定を行う。		
	ただし、V-6欄に示した国の指		
	定を除く。出願人は、これらの 追加される指定が確認を条件と		
	1していること、並びに優先日か	,	
	ら15月が経過する前にその確認 がなされない指定は、この期間		
•	かなされない指定は、この期間	*	
	の経過時に、出願人によって取   り下げられたものとみなされる		
	ことを宣言する。		·
V-6	指定の確認から除かれる国	なし(NONE)	,
VI	優先権主張	なし(NONE)	
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	
VIII	申立て	申立て数	
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	<u> </u>	
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国	-	
	際出願日における出願人の資格 に関する申立て		•
V111-3	先の出願の優先権を主張する国		
	際出願日における出願人の資格		
WITT 4	に関する申立て		
VIII-4	発明者である旨の申立て (米国を指定国とする場合)	<del>-</del>	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性	_	
	要失の例外に関する申立て		'
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	5	-
IX-2	明細書	23	_
IX-3	請求の範囲	2	_
IX-4	要約	1	EZABST00.TXT
JX-5	図面	17	_
IX-7	合計	48	
	添付書類	添付	添付された電子データ
8-X1	手数料計算用紙	· ✓	-
IX-9	個別の委任状の原本	✓	_
IX-11	包括委任状の写し	<b>√</b>	_
IX-17	PCT-EASYディスク	_	
IX-18	その他	納付する手数料に相当する	フレキシフ・ルテ・ィスク
		特許印紙を貼付した書面	<del></del>
1X-19	更約事ととよに担示する図の来	75円   1   1   1   1   1   1   1   1   1	
	要約書とともに提示する図の番 号	<b>1</b>	
IX-20	国際出願の使用言語名:	日本語	
	best to the back to best to best best -		

547878W001

12.11.12.1000/ ANEI 1084007J 0089					
X-1	提出者の記名押印	災富弁			
X-1-1	氏名(姓名)	宮田 金雄 甲雄士			
	受理官庁記入欄				
10-1	国際出願として提出された書類  の実際の受理の日		26.11.03		
10-2	図面:				
10-2-1	受理された		•		
10-2-2	不足図面がある				
10-3	国際出願として提出された書類 を補完する書類又は図面であっ てその後期間内に提出されたも のの実際の受理の日(訂正日)				
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日				
10-5	出願人により特定された国際調 査機関	ISA/JP	: .		
10-6	調査手数料未払いにつき、国際 調査機関に調査用写しを送付し ていない				
国際事務局記入欄					
11-1	記録原本の受理の日				

#### 明 細 書

#### 微量含有物の分析方法

#### 5 技術分野

この発明は、材料中の微量含有物の分析方法に関するものであり、詳しくは、材料中に含まれる添加剤などの微量含有物の分析方法に関するものである。

#### .10 背景技術

第22図は、例えば「高分子添加剤の分離・分析技術」技術情報協会 編の19頁から21頁に記載されている、ポリプロピレン(PPと略記 する)やポリエチレン(PEと略記する)などのポリオレフィン系樹脂 中に含まれる添加剤を分析する従来の方法の系統図である。

15 最初に、試料であるポリオレフィン系樹脂のペレットから、沸点近くまで加熱したクロロホルムなどの溶剤を用い、8時間かけて添加剤を抽出する(A処理と称す)。しかも、この抽出処理を2回行い、すべての添加剤を抽出する。

次に、クロロホルム抽出成分を脱クロロホルムした後、加熱したアセ 20 トンで1時間の還流抽出 (B処理と称す)を行い、脱アセトンした後の 抽出物を、液体クロマトグラフ分析装置やガスクロマトグラフ分析装置 を用いて分析し、酸化防止剤や難燃剤などの添加剤を、同定し、定量する。

また、クロロホルム抽出残については、加熱したジメチルホルムアミ 25 ド (DMFと略記する) により4時間の抽出 (C処理と称す)を行い、 抽出物を赤外分光分析装置により分析し、金属不活性剤などの添加剤を

同定する。

20

A処理で用いる溶剤には、クロロホルムの他に、容量比で1:1のアセトンとトルエンとの混合溶剤も用いられている。

A処理の方法としては、例えばソクッスレー抽出法が用いられており、この抽出処理は2回に限定されるものではなく、必要に応じて2回以上も行われている。そして、A処理に用いられるソクッスレー抽出法では、溶液を還流して抽出するので一定量の溶液が必要であり、例えばクロロホルムとして約 100ml が必要である。そのため、試料ペレットとしては 10g 程度が用いられる。

10 それと、A処理では、沸点近くまで加熱した溶剤で抽出を行うため、 母材の樹脂も一部抽出され分析の妨害となるので、クロロホルム抽出成 分を、添加剤のみを抽出するアセトンで再抽出処理をして、分析の妨害 成分となる樹脂成分を除いている。

また、A処理において、添加剤のみを抽出する溶剤を用いると、抽出 15 時間がさらに長くなる。

上記のように、従来の微量含有物の分析方法は、抽出処理された含有物を分析する工程では、機器分析を用いるため、長時間を要しないが、 試料調製工程においては、同じ方法での長時間の抽出処理が複数回あるとともに、複数の異なる方法での抽出処理もあり、非常に長時間を要し、微量含有物を迅速に同定し定量することができないとの問題があった。

この発明は、上記のような問題を解決するためになされたものであり、 材料中に含まれる微量の含有物を分析する場合の試料調製が、長時間の 抽出処理を複数回することなしに、しかも、複数の異なる抽出処理もす ることなしに、1回の短時間での抽出処理により行われ、材料中の微量。

25 含有物を迅速に分析する方法を提供するものである。

#### 発明の開示

5

15

20

本発明に係る第1の微量含有物の分析方法は、材料中の含有物を溶剤で抽出し、この抽出物を分析する微量含有物の分析方法において、分析される材料の試料片を試料台上に載置する工程と、試料片から含有物を抽出する溶剤を試料台に滴下し、試料台と試料台に載置された試料片との隙間に溶剤を注入する工程と、室温において試料台と試料片との隙間に注入された溶剤を保持し、試料台と試料片との隙間に保持された溶剤により、試料片から含有物を抽出する工程と、試料片から抽出された含有物を分析する工程とからなるものである。

10 これによれば、抽出時間が短くなり、少量の試料片による材料中の含 有物の精度の良い分析が、短時間にできる。

本発明に係る第2の微量含有物の分析方法は、上記第1の微量含有物の分析方法において、試料片から抽出された含有物を分析する工程が、 試料片から溶剤中に抽出された含有物を抽出溶剤とともに分析すること である。

これによれば、抽出時間が短くなり、少量の試料片による材料中の含 有物の精度の良い分析が、クロマトグラフ分析法により、短時間にでき る。

本発明に係る第3の微量含有物の分析方法は、上記第1の微量含有物の分析方法において、試料片から抽出された含有物を分析する工程が、 試料片から溶剤中に抽出された含有物を、溶剤を揮発させて、試料台と して用いた基板の表面に析出させ、この基板表面に析出された含有物を 分析することである。

これによれば、抽出時間が短くなり、少量の試料片による材料中の含 25 有物の精度の良い分析が、表面分析法により、短時間にできる。

本発明に係る第4の微量含有物の分析方法は、上記第3の微量含有物

の分析方法において、基板表面に析出された含有物を分析する方法が、 飛行時間型二次イオン質量分析法である。

これによれば、抽出時間が短くなり、少量の試料片による材料中の含有物の精度の良い分析が、短時間にできる。特に微量な含有物の分析が可能になる。

本発明に係る第5の微量含有物の分析方法は、上記第1の微量含有物の分析方法において、試料片から含有物を抽出する工程が、室温において試料台と試料片との隙間に溶剤を保持した状態で振動を加え、試料台と試料片との隙間に保持された溶剤により、試料片から含有物を抽出することである。

これによれば、抽出時間が短くなり、少量の試料片による材料中の含 有物の精度の良い分析が、短時間にできる。特に、試料片からの抽出物 の量が増加し、抽出物の分析精度が向上する。

10

25

本発明に係る第6の微量含有物の分析方法は、上記第1の微量含有物の分析方法において、試料片から含有物を抽出する工程が、抽出に用いる溶剤の室温における飽和蒸気雰囲気中で、試料台と試料片との隙間に溶剤を保持し、試料台と試料片との隙間に保持された溶剤により、試料片から含有物を抽出することである。

これによれば、抽出時間が短くなり、少量の試料片による材料中の含 20 有物の精度の良い分析が、短時間にできる。特に、抽出に用いる溶剤の 再滴下が不要となり、分析プロセスが簡便となる。

本発明に係る第7の微量含有物の分析方法は、上記第4の微量含有物の分析方法において、試料台と試料片との隙間に保持され、試料片から含有物を抽出する溶剤が、この溶剤に溶解する銀化合物を添加した溶液である。

これによれば、抽出時間が短くなり、少量の試料片による材料中の含

有物の精度の良い分析が、短時間にできる。特に、材料中の抽出物を、 飛行時間型二次イオン質量分析法で分析する感度が、大幅に向上する。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明の材料中の微量含有物を分析する方法を説明する工程 図、第2図は本発明の分析方法における抽出溶剤を滴下した状態を示す 図、第3図は本発明の分析方法における抽出物を分析装置で分析する検 体を調製する第1の方法を示す図、第4図は本発明の分析方法における 抽出物を分析装置で分析する検体を調製する第2の方法を示す図、第5 図は実施例1の測定結果の一例としての酸化防止剤を500ppm含有する 10 HDPEペレットから抽出した抽出溶液のクロマトグラム、第6図は実 施例1の50ppm、100ppm、500ppm、1000ppmの各濃度の酸化防止剤 を含有するHDPEペレットから抽出した抽出溶液を分析したクロマト グラムのピークAの面積と酸化防止剤の含有濃度との関係を示す図、第 7図は実施例2の測定結果の一例としての臭素系難燃剤を0.1%含有す 15 るPPペレットから抽出した抽出物の赤外吸収スペクトル、第8図は実 施例2の0.1%、1%、10%の各濃度の臭素系難燃剤を含有するPPペレ ットから抽出した抽出物を分析した赤外吸収ピークの吸光度と臭素系難 .燃剤の含有濃度との関係を示す図、第9図は実施例3の測定結果の一例 としての臭素系難燃剤を0.1%含有するPPペレットから抽出した抽出 20 物の光電子分光スペクトル、第10図は実施例3の0.1%、1%、10%の 各濃度の臭素系難燃剤を含有するPPペレットから抽出した抽出物を分 析した光電子分光スペクトルの69eV付近のピーク面積値と臭素系難燃 剤の含有濃度との関係を示す図、第11図は実施例4の測定結果の一例 としての酸化防止剤を500ppm含有するHDPEペレットから抽出した 25 抽出物の質量スペクトル、第12図は実施例4の10ppm、50ppm、

100ppm、500ppm、1000ppmの各濃度の酸化防止剤を含有するHDP Eペレットから抽出した抽出物を分析した質量スペクトルのピーク面積 比 (775M+/28Si+) と酸化防止剤の含有濃度との関係を示す図、第 13図は実施例5の測定結果の一例としての臭素系難燃剤を100ppm含 有するPPペレットから抽出した抽出物の質量スペクトル、第14図は 実施例5の1ppm、10ppm、100ppm、1000ppm、1%、10%の各濃度の 臭素系難燃剤を含有するPPペレットから抽出した抽出物を分析して得 られた質量スペクトルのピーク面積比 (<sup>7 9</sup>Br<sup>-</sup>/<sup>1 0 7</sup>Ag<sup>-</sup>) と臭素系難燃 剤の含有濃度との関係を示す図、第15図は実施例6の測定結果の一例 としての臭素系難燃剤を0.1%含有するHIPSペレットから抽出した 10 抽出物の質量スペクトル、第16図は実施例6の0.1%、1%、10%の各 濃度の臭素系難燃剤を含有するHIPSペレットから抽出した抽出物を 分析して得られた質量スペクトルのピーク面積比 {1068(B+Ag)+/10 <sup>7</sup>Ag<sup>+</sup>} と臭素系難燃剤の含有濃度との関係を示す図、第17図は実施 例7における試料片から含有物を抽出する状態を示す図、第18図は実 15 施例7の方法により酸化防止剤を500ppm含有するHDPEペレットか ら抽出した抽出物の質量スペクトル、第19図は実施例8における試料 片から含有物を抽出する状態を示す図、第20図は実施例8の方法によ り臭素系難燃剤を100ppm含有するPPペレットから抽出した抽出物の 質量スペクトル、第21図は実施例9の方法により臭素系難燃剤を 20 0.1%含有するHIPSペレットから抽出した抽出物の質量スペクトル、 第22図はポリオレフィン系樹脂中に含まれる添加剤を分析する従来の 方法の系統図である。

### 25 発明を実施するための最良の形態

第1図は本発明の材料中の微量含有物を分析する方法を説明する工程

図である。

25

第1の工程は、分析する物質を含有する材料の試料片1を試料台2上に載置する{第1図(a)}。第2の工程は、試料片1から含有物を抽出する溶剤3を、試料台2に滴下し、試料台2と試料片1との隙間に注入する{第1図(b)}。第3の工程は、室温において試料台2と試料片1との隙間に注入された溶剤3を短時間保持し、試料台2と試料片1との隙間に保持された溶剤3により、試料片1から分析する含有物を抽出する{第1図(c)}。第4の工程は、試料片1から抽出された含有物を機器分析装置10にて分析する{第1図(d)}。

- 10 本発明の分析方法において、分析対象となる材料は、プラスチックス、 ゴム、接着剤、封止樹脂、注形樹脂などの高分子材料が挙げられる。こ れらの材料は、原材料の状態ばかりではなく、機器の筺体、モールト\*製 品、プリント配線板などの機器の部品に用いられた状態の材料も分析対 象である。
- 15 本発明の分析方法において、分析する含有物としては、材料の酸化防止剤、難燃剤、硬化触媒、加工助剤などの副資材や、原材料製造時や材料を各種製品の部材へ成形加工する時に含有される可能性がある微量な物質などが挙げられるが、対象となる材料から溶剤により抽出されるものであれば特に限定されない。
- 20 本発明の分析方法において、試料片は、樹脂のペレットの1粒程度の少量(例えば、重量で $0.1\sim0.5$ g)であっても良い。

本発明の分析方法において、試料片を載置する試料台は、試料片を載置できる平坦な面を有するものであれば良く、特に基板が好ましい。試料台の材質としては、分析される物質を含まない、ガラス材料、無機材料、金属材料、耐薬品性を有するプラスチック材料など挙げられる。

分析方法が、液体クロマトグラフ法、ガスクロマトグラフ法ないし液

体クロマトグラフ質量分析法の場合では、具体的には、ガラス基板、シリコン基板、ゲルマニウム基板、銀基板、金基板、テフロン基板、テフロンをコーティングしたステンレス(SUSと略記する)の基板、ガラスシャーレ、銀容器、金容器、テフロン容器などが用いられる。また、分析方法が、赤外分光分析の場合は、具体的には、シリコン基板、ゲルマニウム基板、テフロンをコーティングしたSUSの基板などが用いられる。また、分析方法が、X線光電子分光法の場合は、シリコン基板が用いられる。また、分析方法が、飛行時間型二次イオン質量分析法の場合は、シリコン基板、ゲルマニウム基板、銀基板、金基板、銀や金をめっきしたSUSの基板などが用いられる。

第2図は、本発明の分析方法における抽出溶剤を滴下した状態を示す図である。第2図に示すように、試料片1のペレットを載置した試料台2である基板へ、マイクロシリンジ4を用いて抽出溶剤3を滴下する。滴下量は、少なくとも基板2と試料片1との隙間を満たすことができる量から試料片の体積の2倍の量であれば良く、例えば、試料片1が1粒の樹脂ペレットであれば、 $5\sim100\,\mu$ 1である。そして、滴下する場所は基板2上であれば特に限定されないが、基板2の試料片1が載置された部分の近傍、特に、試料片1が載置された部分と載置されていない部分との境界部に滴下するのが、基板2と試料片1との隙間に溶剤3を効率良く注入することができるので好ましい。

15

20

25

本発明の分析方法における、試料片1からの含有物の抽出は、少なくとも基板2と試料片1との隙間に溶剤3が保持される状態を、室温にて短時間維持し、試料片に接した溶剤3、特に、基板2と試料片1との隙間の溶剤3中に含有物を抽出する。この時、溶剤が揮発して減少するので、所定の時間が経過後、溶剤3を再度滴下しても良い。抽出時間、すなわち基板2と試料片1との隙間に溶剤3が保持される状態を維持し、

含有物を抽出する時間は、例えば、試料片1が1粒の樹脂ペレットであれば、0.5~30分が好ましく、0.5~15分がさらに好ましい。この時間が0.5分未満であると、抽出が不十分となり、分析精度が低下する。また、30分より長くても、抽出量が増えることなく、再度滴下する回数が増えるのみで、分析プロセスが複雑となるとともに、分析時間が長くなる。

また、試料片1から溶剤3への含有物の抽出量を増やすため、抽出処理中に基板2を振動しても良い。振動方法としては、超音波洗浄器や振とう器を用いたり、超音波振動子を基板2に貼り付ける方法が挙げられる。

10

15

20

また、基板2と、試料片1と、基板2と試料片1との隙間に保持された溶剤3とを密閉容器中において、抽出溶剤3と同じ溶剤の飽和蒸気雰囲気中で溶剤3による試料片1からの含有物の抽出を行っても良い。このようにすると、揮発による溶剤3の消失が防止でき、追加の溶剤滴下が不要となり、分析プロセスが簡易となる。

第3図は、本発明の分析方法における、抽出物を分析装置で分析する 検体を調製する第1の方法を示す図である。この第1の方法は、特に、 液体クロマトグラフ法、ガスクロマトグラフ法ないし液体クロマトグラ フ質量分析法などのクロマトグラフ分析法にて抽出物を分析する場合に 用いるものであり、第3図に示すように、抽出物を含有した溶液5を基 板2から、マイクロシリンジ6を用いて試料容器7に採取する。そして、 この採取された溶液5が分析装置に注入され、材料中の含有物が分析さ れる。

第4図は、本発明の分析方法における、抽出物を分析装置で分析する 25 検体を調製する第2の方法を示す図である。この第2の方法は、蛍光X 線分析法、飛行時間型二次イオン質量分析法、赤外分光分析法ないしX 線光電子分光分析法のいずれかにて抽出物を分析する場合に用いるのものであり、第4図に示すように、抽出物を含有した溶液5の溶剤3を揮発して、抽出物8を基板2の表面に析出さす。そして、抽出物8が析出された基板表面を分析装置で直接分析する。

本発明の分析方法において、特に、抽出物を飛行時間型二次イオン質量分析法で分析する場合、抽出物が多いと析出部分が帯電するので、帯電を防止のため、基板には、銀、金、銀または金をめっきしたSUSの基板を用いるのが好ましい。

本発明の分析方法において、抽出に用いる溶剤は、室温にて、材料を 10 分解することなく含有物を抽出するものが用いられる。用いられる溶剤 のグレードは、含有物の分析におよぼす影響が小さいので、分析用グレ ードの純度を有するものが好ましい。

本発明の分析方法において、特に、飛行時間型二次イオン質量分析法で抽出物を分析する場合は、含有物を抽出する溶剤に溶解し、測定対象物質を不純物として含まない銀化合物を添加した溶液を用いると、帯電する基板を用いても帯電が防止できるとともに、分析感度があがり、分析精度が向上する。

本発明の分析方法では、試料台上に試料片を載置し、滴下により試料台と試料片との隙間に溶剤を注入し、注入された溶剤を試料台と試料片との隙間に保持し、この保持された溶剤で含有物を抽出して、抽出物を機器分析するので、抽出時間が短くなり、少量の試料片による材料中の含有物の精度の良い分析が、短時間にできる。

以下、さらに具体的な本発明の実施例を示すが、本発明がこれら実施 例に限定されるものではない。

25 実施例1.

15

20

試料として、酸化防止剤を重量含有率で、50ppm、100ppm、

500ppm、1000ppmの各々を含有した高密度ポリエチレン(HDPEと略記する)を準備した。HDPEにはHJ340 {日本ポリケム(株)社製}を用い、酸化防止剤には、1,3,5-トリメチル-2,4,6-トリス(3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン {英語名:1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-buthyl-4-hydroxybenzyl)benzene} {商品名:Irganox1330:Aldrich社製}を用いた。試料片1として、上記各濃度に相当する酸化防止剤をHDPEに添加して混練し、1粒の寸法が5mm×3mm×3mmで重量が約2gのペレットを調製した。

第2図に示すのと同様にして、試料片1であるHDPEペレットの1粒を試料台2であるシリコン基板に載置し、試料片1であるHDPEペレットの近傍に、マイクロシリンジ4を用い抽出溶剤3であるクロロホルムの20 $\mu$ 1を滴下し、HDPEペレットとシリコン基板との隙間にクロロホルムを注入し、保持した。クロロホルムは、HDPEを抽出せず、上記酸化防止剤を抽出する溶媒である。滴下後10分間、室温で放置するが、この間にクロロホルムが揮発して減少するので、2分間おきに、20 $\mu$ 1のクロロホルムを追加して滴下した。用いたクロロホルムは、液体クロマトグラフ用グレード {和光純薬工業(株)社製}である。

10

15

20

第3図に示すのと同様にして、10分間放置後、試料片1であるHD PEペレットと試料台2であるシリコン基板との隙間の抽出物を含有し た溶液5であるクロロホルム溶液をマイクロシリンジ6を用いて試料容 器7に移し、 $50\mu$ lに定容した。ここまでの所要時間は12分であった。 この試料容器7中の溶液を液体クロマトグラフ質量分析装置に注入して、 酸化防止剤量を測定した。

液体クロマトグラフ装置はHP8900型 {アジレントテクノロジー25 ズ社製}を、質量分析装置はLC-mate型 {日本電子(株)社製}を、 有機物分離用カラムは、内径4.6mm×長さ150mmであるInertsil OD S-3型 {GLサイエンス社製} を使用した。液体クロマトグラフの測定条件は、溶離液をメタノールと水のグラジエントモードとし、流量は1ml/分とした。質量分析の測定条件は、イオン化法として大気圧化学イオン化法を用い、正イオンモードとし、測定範囲は、フラグメントの質量数mと電荷 z との比である質量電荷比(m/zと略記する)が1~1000とし、スキャン測定した。

第5図は、測定結果の一例としての酸化防止剤を500ppm含有するHDPEペレットから抽出した抽出溶液のクロマトグラムである。ピーク Aは酸化防止剤の分離ピークを示し、ピークBは同ペレットに含有する シランカップリング剤のものである。これらピークの同定は当該物質の標準試料測定による質量スペクトルおよびクロマトグラムの保持時間の照合により確認した。ピーク Aのピーク面積値は、5000countsであった。

第6図は上記の50ppm、100ppm、500ppm、1000ppmの各濃度の酸化防止剤を含有するHDPEペレットから抽出した抽出溶液を分析したクロマトグラムのピークAの面積と酸化防止剤の含有濃度との関係を示す図である。酸化防止剤の含有濃度とクロマトグラムのピークAの面積との間に良好な直線関係が認められた。

本実施例では、HDPEペレットから含有物である酸化防止剤を抽出 20 処理する時間は12分間であり、短時間の抽出処理により含有物の酸化 防止剤を定量分析することが可能であることが判明した。このように、 本実施例での分析方法では、従来の方法に比べ、抽出処理時間が大幅に 短縮され、HDPE中の含有物である酸化防止剤を迅速に分析すること ができた。

25 実施例2.

10

試料として、添加剤である臭素系難燃剤を重量含有率で、0.1%、1%、

10%の各々を含有したPPを準備した。PPにはBCO3B {日本ポリケム (株) 社製}を用い、臭素系難燃剤にはデカブロモジフェニルエーテル {英語名:Decabromodiphenylether} {和光純薬工業 (株) 社製}を用いた。試料片1として、上記各濃度に相当する臭素系難燃剤をPPに添加して混練し、1粒の寸法が5mm×3mm×3mmで重量が約0.3gのペレットを調製した。

第2図に示すのと同様に、試料片1であるPPペレットの1粒を、試料台2であるフッ素樹脂コーティングされたSUS基板に載置し、PPペレットの近傍に、マイクロシリンジ4を用い抽出溶剤3であるトルエンの20μ1を滴下し、PPペレットとフッ素樹脂コーティングされたSUS基板との隙間にトルエンを注入し、保持した。トルエンは、PPを抽出せず、上記臭素系難燃剤を抽出する溶媒である。滴下後10分間、室温で放置するが、この間にトルエンが揮発して減少するので、5分間後に、20μ1のトルエンを追加して滴下した。用いたトルエンは、液体クロマトグラフ用グレード {和光純薬工業(株)社製}である。

10

15

20

最初のトルエン滴下から10分間後は、滴下したトルエンは揮発しており、PPペレットおよび上記基板は乾燥状態になった。そして、上記基板からPPペレットを取り去ると、第4図に示したのと同様、基板表面には、ペレットからの抽出物が濃縮物として析出していた。

この基板表面の析出物を顕微フーリエ変換赤外分光法で分析した。顕微フーリエ変換赤外分光装置は JIR-5500型 {日本電子(株)社製}を使用した。測定条件は、反射モードとし、測定波数範囲は、700~4000cm<sup>-1</sup>、波数分解能は2cm<sup>-1</sup>とした。

第7図は、測定結果の一例としての臭素系難燃剤を0.1%含有するP 25 Pペレットから抽出した抽出物の赤外吸収スペクトルである。第7図に 示すように、1300cm<sup>-1</sup>付近にデカプロモジフェニルエーテルに起因す る赤外吸収ピークが認められた。

第8図は、上記の0.1%、1%、10%の各濃度の臭素系難燃剤を含有するPPペレットから抽出した抽出物を分析した赤外吸収ピークの吸光度と臭素系難燃剤の含有濃度との関係を示す図である。臭素系難燃剤の含有濃度と赤外吸収ピークの吸光度との間に良好な直線関係が認められた。本実施例では、PPペレットから含有物である臭素系難燃剤を抽出処理する時間は10分間であり、短時間の抽出処理により含有物の臭素系難燃剤を定量分析することが可能であることが判明した。このように、本実施例での分析方法では、従来の方法に比べ、抽出処理時間が大幅に短縮され、PP中の含有物である臭素系難燃剤を迅速に分析することができた。

実施例3.

20

25

試料台2である基板にシリコン基板を用いた以外、実施例2と同様にして、抽出溶剤の滴下処理、抽出処理、抽出物の析出固化処理を行った。本実施例では、基板表面の析出物をX線光電子分光分析法で分析した。X線光電子分光装置は、QUANTUM2000型 {フィジカルエレクトロニクス社製}を使用し、測定範囲は60~80eVとした。

第9図は、測定結果の一例としての臭素系難燃剤を0.1%含有するP Pペレットから抽出した抽出物の光電子分光スペクトルである。第9図に示すように、<math>69eV付近にデカブロモジフェニルエーテルの臭素の  $3d_{3/2}$ 軌道および $3d_{5/2}$ 軌道に起因する光電子分光スペクトルが明瞭に認められ、このスペクトルのピーク面積値は20であった。

第10図は、上記の0.1%、1%、10%の各濃度の臭素系難燃剤を含有するPPペレットから抽出した抽出物を分析した光電子分光スペクトルの69eVのピーク面積値と臭素系難燃剤の含有濃度との関係を示す図である。臭素系難燃剤の含有濃度と上記ピーク面積値との間に良好な直線

関係が認められた。

本実施例でも、PPペレットから含有物である臭素系難燃剤を抽出処 理する時間は10分間であり、短時間の抽出処理により含有物の臭素系 難燃剤を定量分析することが可能であることが判明した。このように、 本実施例での分析方法でも、従来の方法に比べ、抽出処理時間が大幅に 短縮され、PP中の含有物である臭素系難燃剤を迅速に分析することが できた。

実施例4.

5

20

試料片1として、酸化防止剤を重量含有率で、10ppm、50ppm、 100ppm、500ppm、1000ppmの各々を含有したHDPEペレットを調 10 製した以外、実施例1と同様にして、抽出溶剤の滴下処理、抽出処理を 行った。本実施例では、最初にクロロホルムを滴下した10分間後、ク ロロホルムの再滴下はおこなわず、2分間室温に放置しクロロホルムを 揮発させ、基板表面にペレットからの抽出物を濃縮物として析出させた。 本実施例では、基板表面の析出物を飛行時間型二次イオン質量分析法 15 で分析した。飛行時間型二次イオン質量分析装置は、TRIFTII型{ア ルバックファイ社製}を使用した。測定条件は、一次イオンとして 69Ga+イオンを用い、二次イオンの測定モードは正イオンモード、測定

範囲は、m/z=1~1000、質量分解能は∠M/M=5000程度とした。

第11図は、測定結果の一例としての酸化防止剤を500ppm含有する HDPEペレットから抽出した抽出物の質量スペクトルである。第11 図に示すように、m/zが775に酸化防止剤のフラグメントに起因する質 量ピークが認められた。このm/zが775のピークの面積 $^{775}$ M $^+$ を、基板 のシリコンのフラグメントによるm/zが28のピークの面積28 S i +で規 格化した (<sup>775</sup>M+/<sup>28</sup>Si+) 面積比の値を用いて定量分析した。酸化 25° 防止剤を500ppm含有するHDPEペレットから抽出した抽出物の上記 面積比の値は5であった。

第12図は、上記の10ppm、50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm の各濃度の酸化防止剤を含有するHDPEペレットから抽出した抽出物を分析した質量スペクトルのピーク面積比( $^{775}M^{+/28}Si^{+}$ )と酸化防止剤の含有濃度との関係を示す図である。酸化防止剤の含有濃度とピーク面積比( $^{775}M^{+/28}Si^{+}$ )との間に良好な直線関係が認められ、特に、10ppmとの微量な濃度まで検出可能であった。

本実施例では、HDPEペレットからの含有物である酸化防止剤の抽出処理時間は12分間であり、短時間の抽出処理により含有物の酸化防止剤を微量な濃度まで定量分析することが可能であることが判明した。このように、本実施例での分析方法でも、従来の方法に比べ、抽出処理時間が大幅に短縮でき、HDPE中に10ppmと微量に含有する酸化防止剤を迅速に分析することができた。

実施例5.

10

- 15 試料片1として、実施例2と同様な方法により、臭素系難燃剤を重量含有率で、1ppm、10ppm、100ppm、1000ppm、1%、10%の各濃度で含有したPPペレットを調製した。次に、試料台2である基板に銀基板を用いた以外、実施例2と同様にして、基板表面に、PPペレットからの抽出物を、濃縮物として析出させた。
- 20 本実施例では、基板表面の析出物を飛行時間型二次イオン質量分析法で分析した。飛行時間型二次イオン質量分析装置は、TRIFTⅡ型{アルバックファイ社製}を使用した。測定条件は、一次イオンとして69Ga+イオンを用い、二次イオンの測定モードは負イオンモード、測定範囲はm/z=1~200、質量分解能は∠M/M=5000程度とした。
- 25 第13図は、測定結果の一例としての臭素系難燃剤を100ppm含有する PPペレットから抽出した抽出物の質量スペクトルである。第13図

に示すように、m/zが79に臭素元素のフラグメントに起因する質量スペクトルのピークが認められた。このm/zが79のピーク面積 $^{7.9}$ Br $^{-}$ を、基板の銀のフラグメントによるm/zが10.7ピーク面積 $^{1.0.7}$ Ag $^{-}$ で規格化した( $^{7.9}$ Br $^{-}$ / $^{1.0.7}$ Ag $^{-}$ )ピーク面積比の値を用いて定量分析した。

第14図は、上記の1ppm、10ppm、100ppm、1000ppm、1%、10%の各濃度の臭素系難燃剤を含有するPPペレットから抽出した抽出物を分析して得られた質量スペクトルのピーク面積比(7<sup>9</sup>Br<sup>-</sup>/<sup>107</sup>Ag<sup>-</sup>)と臭素系難燃剤の含有濃度との関係を示す図である。臭素系難燃剤の含有濃度とピーク面積比との間に良好な直線関係が認められ、1ppmとの微量な濃度まで検出可能であった。本実施例では、PPペレットの試料片1から、含有物である臭素系難燃剤の抽出処理時間は10分間であり、短時間の抽出処理により含有物の臭素系難燃剤を微量な濃度まで定量分析することが可能であることが判明した。

このように、本実施例での分析方法でも、従来の方法に比べ、抽出処理時間が大幅に短縮でき、PP中に1ppmと微量に含有する臭素系難燃剤を迅速に分析することができた。

実施例6.

10

15

20

試料として、添加剤である臭素系難燃剤を重量含有率で0.1%、1%、10%、含有させた耐衝撃性ポリスチレン(HIPSと略記する)を準備した。HIPSにはH8672 {PSジャパン(株)社製}を用い、臭素系難燃剤にはデカブロモジフェニルエーテル {和光純薬工業(株)社製}を用いた。試料片1として、上記各濃度に相当する臭素系難燃剤をHIPSに添加して混練し、1粒の寸法が5mm×3mm×3mmで重量が約0.3gのペレットを調製した。

25 第2図に示すのと同様にして、試料片1であるHIPSペレットの1 粒を試料台2である銀基板に載置し、HIPSペレットの近傍に、マイ クロシリンジ4を用い抽出溶剤3のトルエンとメタノールとの混合溶剤 (容積比でトルエン:メタノール=1:1)の20μlを滴下し、HIP Sペレットと銀の基板との隙間に混合溶剤を注入し、保持した。この混合溶剤は、HIPSと臭素系難燃剤とを共に抽出する溶剤である。そこで、滴下30秒間後、HIPSペレットを銀基板から取り除き、HIP Sペレットが取り除かれた銀基板の表面に窒素ガスを30秒間吹き付け、臭素系難燃剤を含有する溶液を乾燥し、銀基板表面に抽出物を析出させた。この混合溶剤滴下から銀基板表面に抽出物を析出させた。この混合溶剤滴下から銀基板表面に抽出物を析出させるまでの処理時間は約1分間であった。

10 本実施例の抽出処理に用いるトルエンとメタノールとのグレードは液体クロマトグラフ用グレード {和光純薬工業(株)製}である。

本実施例では、基板表面の析出物を飛行時間型二次イオン質量分析法で分析した。飛行時間型二次イオン質量分析装置は、TRIFTII型{アルバックファイ社製}を使用した。測定条件は、一次イオンとして69Ga+イオンを用い、二次イオンの測定モードは正イオンモード、測定範囲はm/z=1~1500、質量分解能は

M/M=5000程度とした。

15

20

25

第15図は測定結果の一例としての臭素系難燃剤を0.1%含有するH I P Sペレットから抽出した抽出物の質量スペクトルである。第15図に示すように、m/zが1068に臭素系難燃剤であるデカブロモジフェニルエーテルのフラグメントによるピーク $B^+$ と銀のフラグメントによるピークA  $g^+$ とに起因する質量スペクトルのピークが認められた。このm/zが1068のピークの面積 $^{1068}(B+Ag)^+$ を、基板の銀のフラグメントによるm/zが107のピーク面積 $^{1068}(B+Ag)^+$ を、基板の銀のフラグメントによるm/zが107のピーク面積 $^{107}$ A $g^+$ で規格化した $\{^{1068}(B+Ag)^+$ / $^{107}$ A $g^+\}$ ピーク面積比の値を用いて定量分析した。臭素系難燃剤を0.1%含有するH I P Sペレットから抽出した抽出物の上記面積比の値は0.005であった。

第16図は、上記の0.1%、1%、10%の各濃度の臭素系難燃剤を含有するHIPSペレットから抽出した抽出物を分析して得られた質量スペクトルのピーク面積比 {1068(B+Ag)+/107Ag+} と臭素系難燃剤の含有濃度との関係を示す図である。臭素系難燃剤の含有濃度とピーク面積比との間に良好な直線関係が認められた。本実施例では、HIPSペレットから、含有物である臭素系難燃剤の抽出処理時間は1分間であり、極端に短い時間の抽出処理により含有物の臭素系難燃剤を微量な濃度まで定量分析することが可能であることが判明した。

このように、本実施例での分析方法では、従来の方法に比べ、抽出処理時間が大幅に短縮でき、しかも、HIPS中の臭素系難燃剤など、含有物を抽出する溶剤に溶解する母材中に含まれる含有物でも迅速に分析することができた。

実施例7.

10

15

20

25

本実施例では、実施例4と同様にして、酸化防止剤を重量含有率で 500ppm含有させたHDPEペレットを調製した。この試料片1である HDPEペレットを試料台2であるシリコン基板に載置し、実施例4と 同様にして、抽出溶剤3のクロホルムを滴下し、HDPEペレットとシリコン基板との隙間にクロロホルムを注入し、保持した。そして、実施 例4と同様の12分間の処理にて、溶剤に酸化防止剤を抽出し、この抽 出物の酸化防止剤を基板表面に濃縮物として析出させた。

第17図は、本実施例における試料片から含有物を抽出する状態を示す図である。第17図に示すように、超音波洗浄器41のイオン交換水が注入された洗浄槽42中に設置した支持台43上に、HDPEペレット11を搭載し、HDPEペレット11との隙間にクロロホルム13を保持したシリコン基板12を置いた。そして、抽出処理中、例えば、45kHzの超音波振動をHDPEペレット11とクロロホルム13とシ

リコン基板12とに加えた。本実施例で用いた超音波洗浄器は、ブランソンシリーズ 2510J-DTH型 {ヤマト科学(株)製}である。

本実施例の方法では、含有物の抽出量が増加するので、分析する含有物の量がさらに微量である材料についても、その含有物を短時間に精度 15 よく分析できた。

実施例8.

10

20

本実施例では、実施例5と同様にして、臭素系難燃剤を重量含有率で100ppm含有させた試料片1であるPPペレットを調製した。このペレットを試料台2である銀基板に載置し、実施例5と同様にして、抽出溶剤3のトルエンを滴下し、PPペレットと銀基板との隙間にトルエンを注入し、保持した。PPペレットと銀基板との隙間にトルエンを保持した状態で10分間静置して、トルエン中に臭素系難燃剤を抽出し、この抽出物の臭素系難燃剤を銀基板の表面に濃縮物として析出させた。

第19図は、本実施例における試料片から含有物を抽出する状態を示 25 す図である。第19図に示すように、抽出処理中、PPペレット21を 搭載し、PPペレット21との隙間にトルエン23を保持した銀基板2 2は、トルエン蒸気が飽和した密閉容器51中に設置された。この密閉容器51の底部には蒸気発生用トルエン52が入っており、この蒸気発生用トルエン52の上方には孔を有する棚板53が設けられており、この棚板53にPPペレット21を載置し、PPペレット21との隙間にトルエン23を保持した銀基板22を置いた。

すなわち、PPペレット21から臭素系難燃剤を抽出処理中、PPペレット21が、トルエンの飽和蒸気中にあるので、抽出溶剤であるトルエン23の揮発による消失が防止され、トルエン23の再滴下が不要となり、分析プロセスが簡便となる。

10 抽出後、密閉容器 5 1 から銀基板 2 2 を取り出し、銀基板 2 2 から P Pペレット 2 1 を取り去り、銀基板 2 2 表面に窒素ガスを吹きつけて溶 剤を乾燥し、臭素系難燃剤を銀基板 3 2 表面に濃縮物として析出させた。

すなわち、本実施例の分析方法では、従来の方法に比べ、抽出処理時間が大幅に短縮でき、しかも、抽出溶剤の再滴下が不要となり、さらに簡便なプロセスにより、PP中の含有物である臭素系難燃剤を迅速に分析することができた。

25 実施例9.

15

20

本実施例では、実施例6と同様にして、臭素系難燃剤を重量含有率で

0.1%含有させたHIPSペレットを調製した。

本実施例では、抽出溶剤 3 に過塩素酸銀を飽和させたトルエンとメタ ノールとの混合溶液(容積比でトルエン:メタノール=1:1)を用い た以外、実施例 6 と同様にして、銀基板表面にHIPSペレットからの 抽出物を、濃縮物として析出させた。

すなわち、本実施例の分析方法では、従来の方法に比べ、抽出処理時間が大幅に短縮でき、しかも、抽出物の分析する感度が大幅に向上し、 HIPS中の含有物である臭素系難燃剤を高感度で迅速に分析することができた。

20

25

10

15

#### 産業上の利用可能性

本発明による微量含有物の分析方法は、例えば、プラスチックス、ゴム、接着剤、封止樹脂、注形樹脂などの高分子材料に含有される添加剤などの微量含有物の分析に用いることができる。さらに、上記高分子材料を用いて製造された筐体、モールド製品、プリント配線板などの部品を構成する高分子材料中に含有される微量含有物を分析することができ

る。

#### 請求の範囲

- 1. 材料中の含有物を溶剤で抽出し、この抽出物を分析する微量含有物の分析方法において、分析される材料の試料片を試料台上に載置する工程と、上記試料片から含有物を抽出する溶剤を上記試料台に滴下し、上記試料台と上記試料台に載置された上記試料片との隙間に上記溶剤を注入する工程と、室温において上記試料台と上記試料片との隙間に注入された上記溶剤を保持し、上記試料台と上記試料片との隙間に保持された上記溶剤により、上記試料片から含有物を抽出する工程と、上記試料片から抽出された上記含有物を分析する工程とからなることを特徴とする微量含有物の分析方法。
  - 2. 試料片から抽出された含有物を分析する工程が、上記試料片から溶剤中に抽出された含有物を上記抽出溶剤とともに、クロマトグラフ分析法で分析することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の微量含有物の分析方法。
  - 3. 試料片から抽出された含有物を分析する工程が、試料片から溶剤中に抽出された含有物を、上記溶剤を揮発させて、試料台として用いた基板の表面に析出させ、上記基板表面に析出された含有物を分析することであることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の微量含有物の分析方
- 20 法。

10

15

- 4. 基板表面に析出された含有物を分析する方法が、飛行時間型二次イオン質量分析法であることを特徴とする請求の範囲第3項に記載の微量含有物の分析方法。
- 5. 試料片から含有物を抽出する工程が、室温において試料台と試料片 25 との隙間に溶剤を保持した状態で振動を加え、上記試料台と上記試料片 との隙間に保持された上記溶剤により、上記試料片から含有物を抽出す

ることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の微量含有物の分析方法。

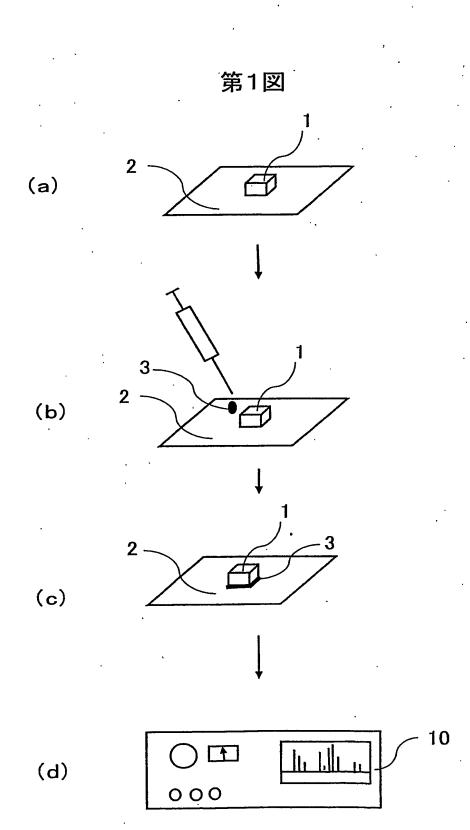
- 6. 試料片から含有物を抽出する工程が、抽出に用いる溶剤の室温における飽和蒸気雰囲気中、試料台と試料片との隙間に溶剤を保持し、上記試料台と上記試料片との隙間に保持された上記溶剤により、上記試料片から含有物を抽出することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の微量含有物の分析方法。
- 7. 試料台と試料片との隙間に保持され、上記試料片から含有物を抽出する溶剤が、この溶剤に溶解する銀化合物を添加した溶液であることを特徴とする請求の範囲第4項に記載の微量含有物の分析方法。

#### 要 約 書

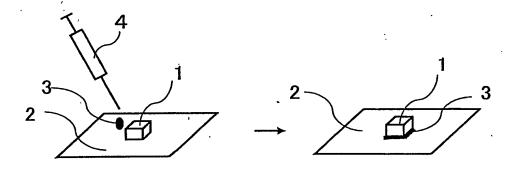
材料中の微量含有物を分析するための試料調製が、長時間の抽出処理 をすることなしに、1回の短時間での抽出処理により行われ、材料中の 微量含有物を迅速に分析する方法を提供する。

本発明の微量含有物の分析方法は、分析される材料の試料片を試料台上に載置する工程と、試料片から含有物を抽出する溶剤を試料台に適下し、試料台と試料台に載置された試料片との隙間に溶剤を注入する工程と、室温において試料台と試料片との隙間に注入された溶剤を保持し、

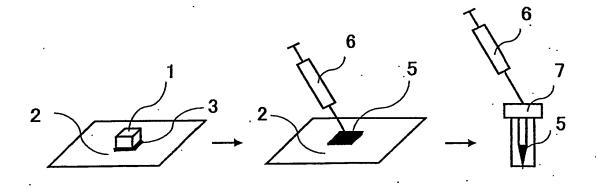
10 試料台と試料片との隙間に保持された溶剤により、試料片から含有物を 抽出する工程と、試料片から抽出された含有物を分析する工程とからな ることである。



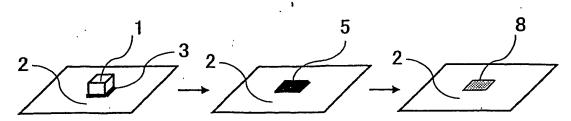
# 第2図



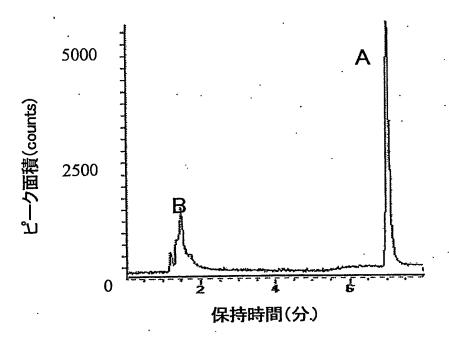
# 第3図



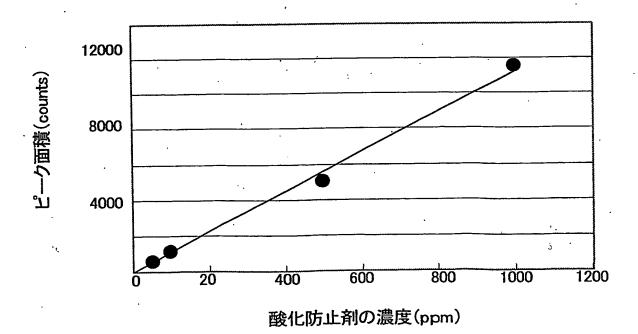
第4図



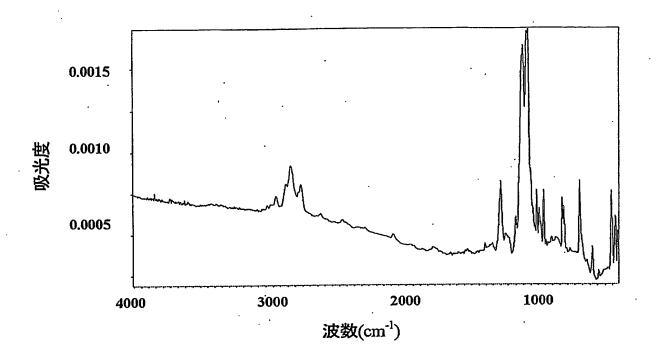
第5図

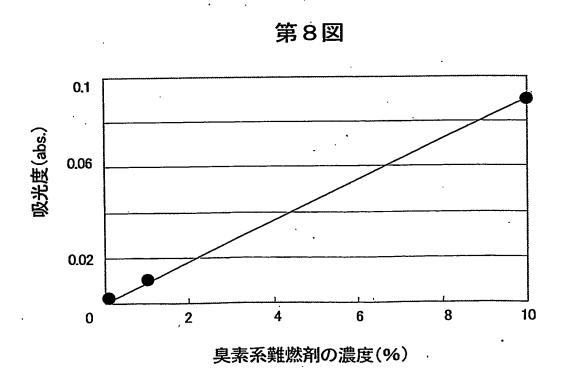


第6図

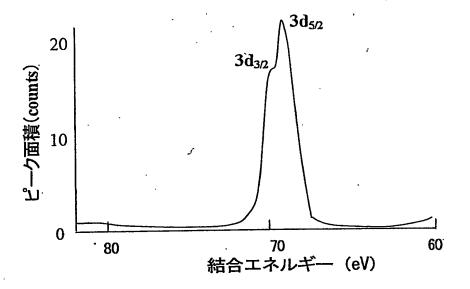


第7図

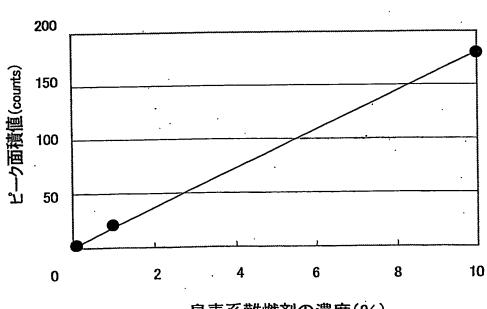




第9図

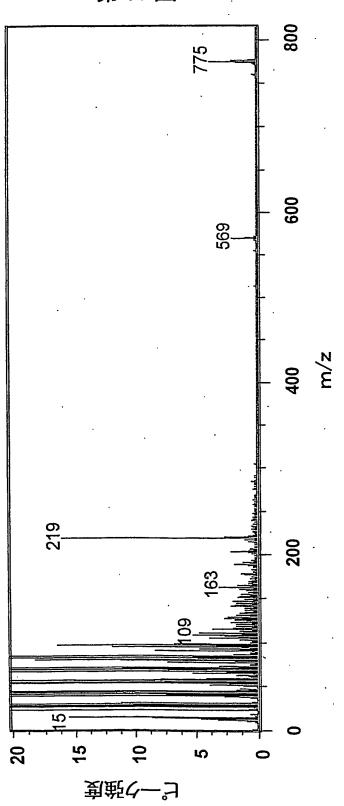


第10図

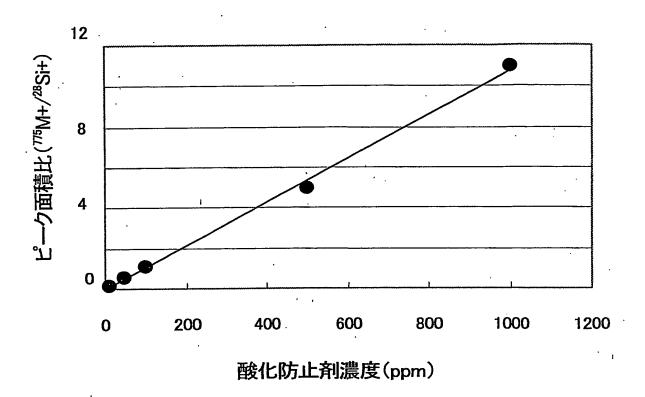


臭素系難燃剤の濃度(%)

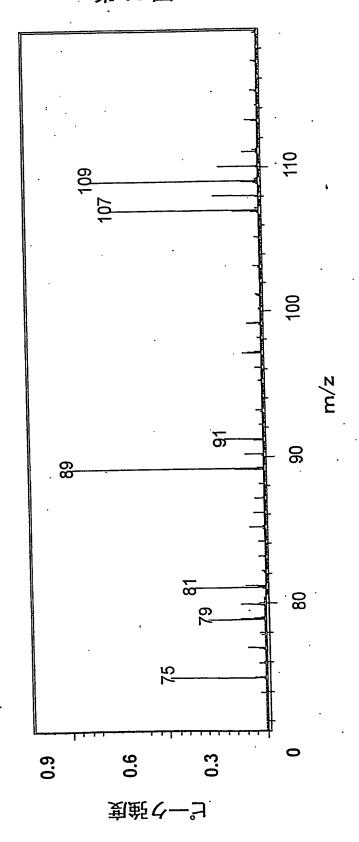




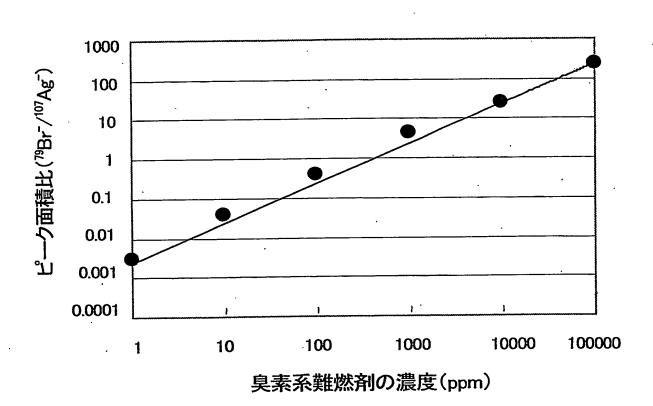
第12図



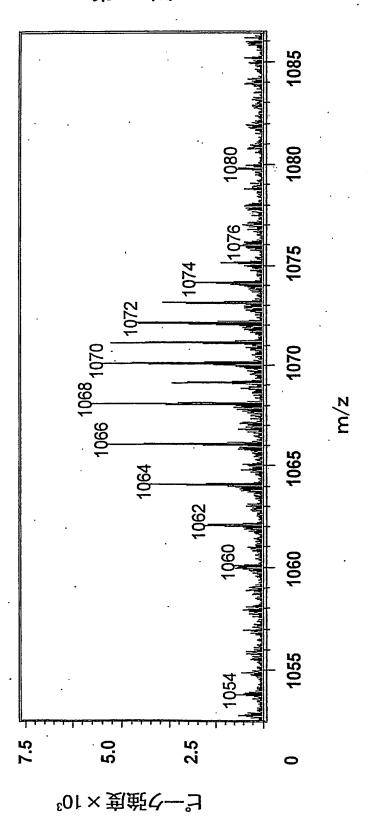
第13図



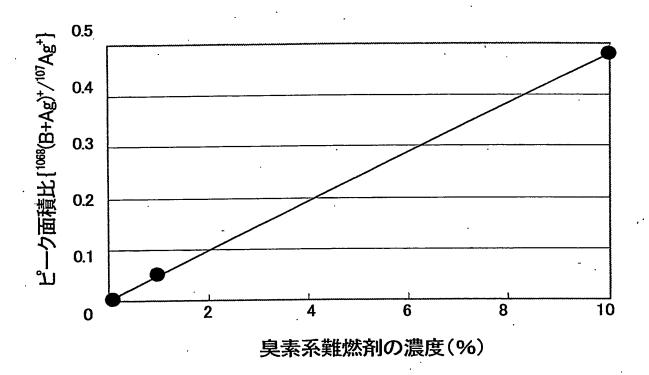
第14図



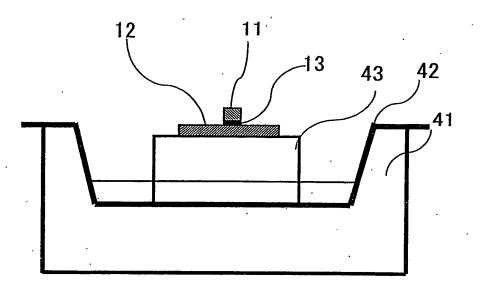
第 15 図



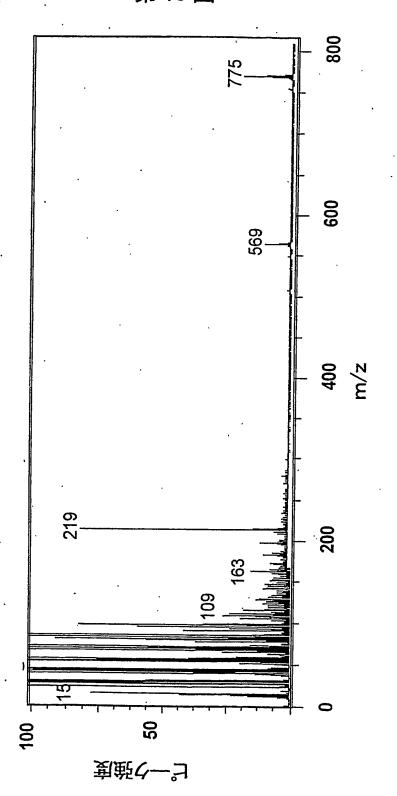
第16図



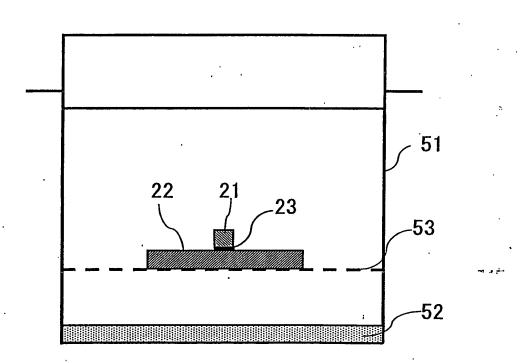
## 第17図



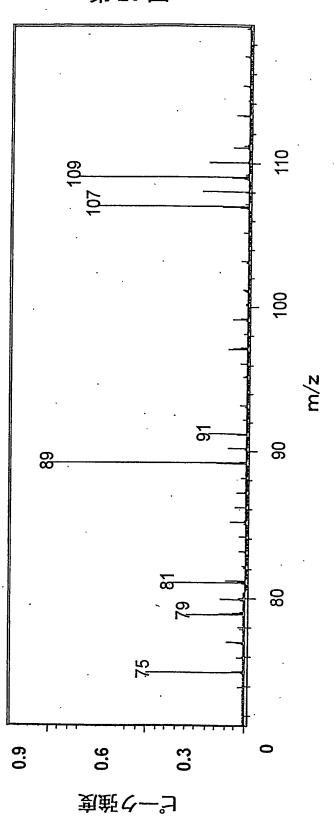
第 18 図



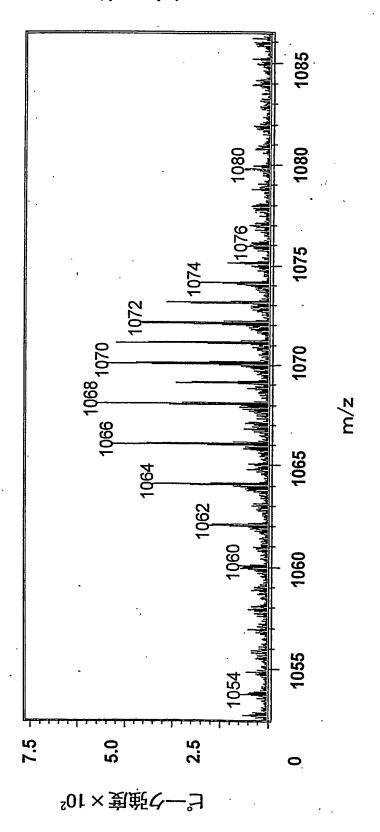
第19図



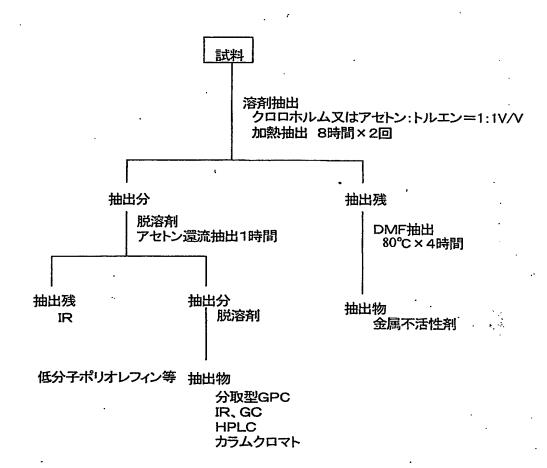




第21図



## 第22図



## Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/015125

International filing date: 14 October 2004 (14.10.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: PCT/JP03/15090

Filing date: 26 November 2003 (26.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 10 February 2005 (10.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)

